

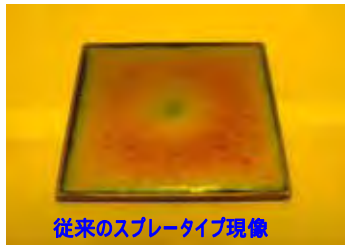


Aqua-45N

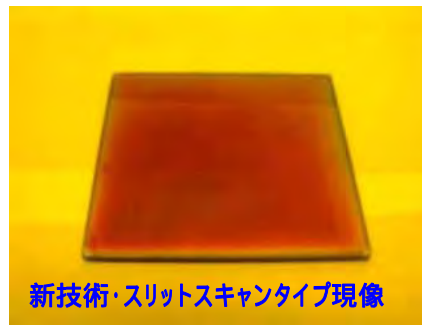
45nm フォトマスク対応 高性能水溶性現像装置 アクア45N

Aqua45N はスプレーインパクトによるパターン倒れ欠陥を防ぐスリットスキャンタイプの現像システムです。

Aqua45N の現像液スキャンノズルは、従来のスプレーノズルから生じる「コーヒークップ」型のディフェクトを解消し、クラストップレベルの CD ユニフォミティを提供します。45nm ノードで求められるレジストの現像プロセスでは、「コーヒークップ」の局所的な凹みはピンホールとなり、決定的な欠陥を作り出しかねません。さらに、Aqua45N では低インパクトの超音波を使用することで、パドル現像プロセスで起こりがちなパターン内のレジスト残渣が引き起こす欠陥の問題を解決します。



従来スプレータイプ現像



新技術・スリットスキャンタイプ現像

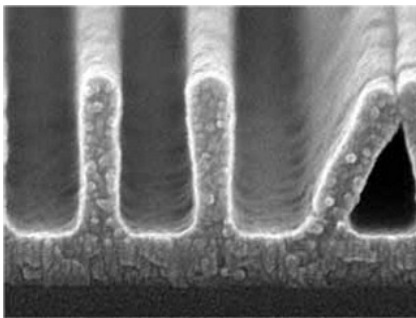


Fig.1 従来スプレー方式
パターン断面

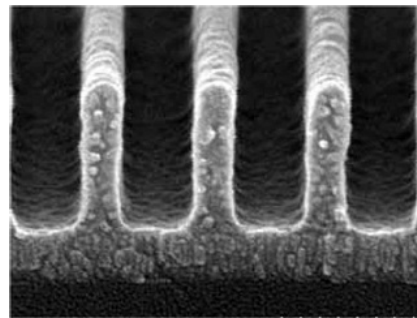


Fig.2 Aqua45N プロセス
パターン断面

システムの特長

低インパクト 棒タイプ超音波	<ul style="list-style-type: none"> 超音波を面で拡散させて作用させることで、欠陥を防ぎます 優れた形状でパワーを最適に作用させます
スリットノズル	<ul style="list-style-type: none"> マスク上のレジスト表面へのスプレーインパクトを与えません クラストップレベルの CD ユニフォミティを提供します
システム構成	<ul style="list-style-type: none"> MTC の標準モジュール互換
高速スキャン	<ul style="list-style-type: none"> マスクのどの箇所でも現像遅れを起こしません

概要
Overview

プロセス
Process

システム
SYSTEM

その他
Other